

XPS-ANALIZA Ni₃Al IN TiAl₃, IONSKO NITRIRANEGA V PULZIRAJOČI PLAZMI

AN XPS ANALYSIS OF Ni₃Al AND TiAl₃ ION NITRIDED IN A PULSED PLASMA

Matjaž Torkar¹, Valery Rosenberg²

¹ Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, Slovenija

² Technion, Faculty of Aerospace Engineering, Haifa, Izrael

matjaz.torkar@imt.si

Prejem rokopisa - received: 2003-10-22; sprejem za objavo - accepted for publication: 2003-12-01

Visoka trdota in nizek koeficient trenja sta ključna parametra pri modernih nanosih in nanokompozitnih tankih plasteh za zmanjšanje obrabe. Kompleksni nitridi intermetalnih zlitin na osnovi titana, aluminija, niklja in železa so obetajoči materiali za visokozmogljive nanose. Preizkušeno je bilo ionsko nitriranje v pulzirajoči plazmi Ni₃Al in TiAl₃, ki sta bila izdelana po SHS (Self propagating high temperature synthesis)-metodi sinteze iz mešanice elementarnih prahov v atmosferi argona. Vsebnost in vrsta nitridov je bila določena z XPS-metodo. Raziskava je potrdila vsebnost nitridov z vezavno energijo 397,2 eV ter nastanek nitridov AlN z vezavno energijo Al 2p 74,6 eV na Ni₃Al, medtem ko nitridov TiN na zlitini TiAl₃ nismo potrdili, verjetno zaradi prenizke temperature ionskega nitriranja.

Ključne besede: reakcijska termosinteza, Ni-, Ti-aluminidi, ionsko nitriranje, nitridi, trde plasti, XPS

A high hardness and a low friction coefficient are two key parameters for the coatings used for wear reduction. The complex nitrides of intermetallics based on titanium, aluminium, nickel and iron are very promising materials for high-performance coatings. The self-propagating high-temperature synthesis (SHS) of elemental powders in an argon atmosphere was used for the production of Ni₃Al and AlTi₃, followed by pulsed-plasma ion nitriding. The results of a combustion synthesis of aluminides of nickel and titanium, followed by ion nitriding are presented. An X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analysis confirmed the formation of nitrides with a binding energy of 397.2 eV and an AlN nitride with a binding energy Al 2p 74.6 eV on Ni₃Al, but the presence of TiN nitrides was not confirmed on TiAl₃.

Key words: reactive thermosynthesis, Ni-, Ti-aluminides, ion nitriding, nitrides, hard coatings, XPS

1 UVOD

Uporaba trdih plasti je razširjena pri orodjih za obdelavo kovin. Posebno pri strojih za odrezavanje pri velikih hitrostih je orodje izpostavljeno velikemu trenju ter mehanskim in termičnim obremenitvam. Nanos debeline nekaj mikrometrov lahko prispeva k povečanju učinkovitosti in povečanju zdržljivosti orodja. Kompleksni nitridi intermetalnih zlitin^{1,2} na osnovi titana, niklja, železa in dušika so obetajoči materiali za nanose z izrednimi lastnostmi, ki so zahtevane pri strojni obdelavi materialov odpornih za abrazijo in težko obdelovalnih materialov.

Vedno bolj pa se uveljavljajo tudi nanokompozitne tanke plasti z maksimalno trdoto med 30 GPa in 60 GPa za uporabo v ekstremnih razmerah³. Poleg visoke trdote in nizkega koeficiente trenja se odlikujejo po termični stabilnosti, žilavosti plasti in dobrri oprijemljivosti s podlago, kar jih dela uporabne kot zaščitne plasti.

Ker na področju ionskega nitriranja aluminidov še nimamo dosti izkušenj⁴, je bil namen opravljen raziskave poizkus identifikacije nitridov po ionskem nitriranju aluminida v pulzirajoči plazmi ter preizkus učinkovitosti tehnike XPS v ta namen.

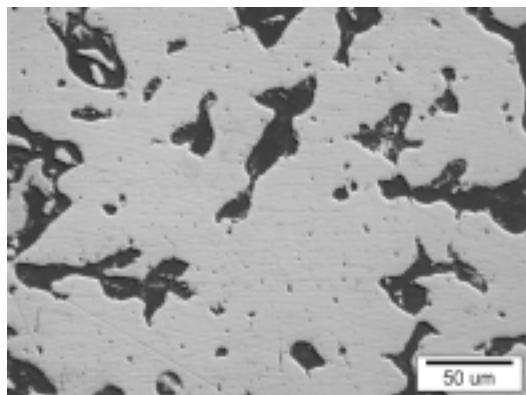
2 EKSPERIMENTALNI DEL

Vzorci za visokotemperaturno reakcijsko sintezo (SHS) so bili pripravljeni iz mešanice elementarnih prahov in hladno stisnjeni v valjčke na Technionu, Faculty of Aerospace Engineering, Haifa, v Izraelu. Pregled vzorcev je podan v tabeli 1.

Po SHS-sintezi so bili vzorci prerezani, zbrušeni in spolirani, metalografsko pregledani in ionsko nitrirani v pulzirajoči plazmi.

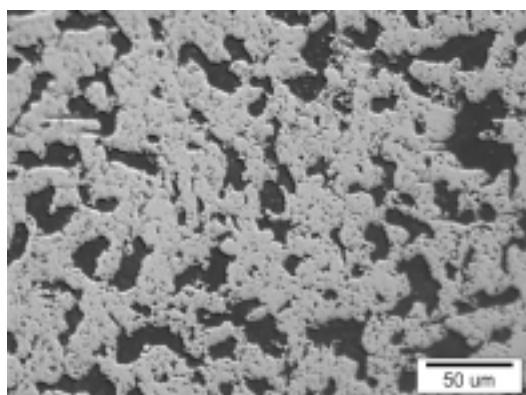
Metalografski pregled prerezanih vzorcev po SHS-sintezi je pokazal, da so vsi vzorci porozni (slike 1, 2). Polirana površina valjčkov iz Ni₃Al in TiAl₃ (slike 3, 4), izdelanih z SHS-sintezo, je bila ionsko nitrirana v pulzirajoči plazmi pri naslednjih pogojih: Ni₃Al – 540 °C, 1 ura + 580 °C, 3 ure ter TiAl₃ – 540 °C, 1 ura + 580 °C, 3 ure, pri sestavi plina: 11,5 % H₂, 87 % N₂, 1,5 % CH₄.

Pri meritvi trdote HV 0,3 in mikrotrdote HV 0,025 nitrirane površine nismo mogli nedvoumno dokazati opaznega povečanja trdote. Meritve je otežila tudi poroznost vzorcev, kar je vplivalo na izmerjene vrednosti in raztros izmerjenih trdot. Poleg tega je bila domnevna plast nitridov pretanka, da bi jo bilo mogoče identificirati z navadnimi metodami merjenja trdote in



Slika 1: Poroznost vzorca Ni₃Al po SHS-sintezi

Figure 1: Porosity of Ni₃Al sample after SHS synthesis



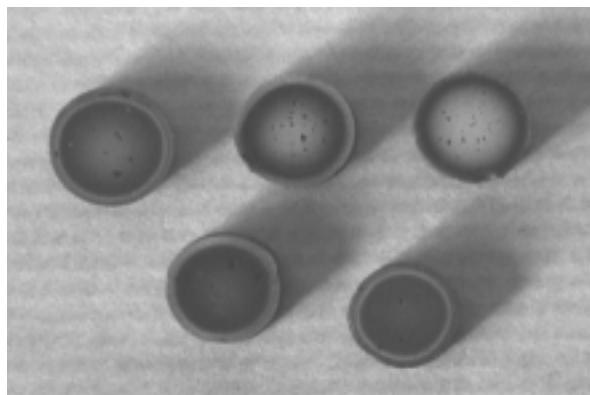
Slika 2: Poroznost vzorca TiAl₃ po SHS-sintezi

Figure 2: Porosity of TiAl₃ sample after SHS synthesis

optično mikroskopijo. Zato smo za identifikacijo nastanka nitridov pri danih eksperimentalnih pogojih uporabili rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo (XPS). Ta metoda analize površine namreč omogoča pridobitev informacij o kemijskem okolju, v katerem se nahaja element. Rezultate XPS-meritev smo primerjali z referenčno datoteko za vezavne energije, ki je dostopna na spletnem naslovu <http://srdata.nist.gov/xps/>.

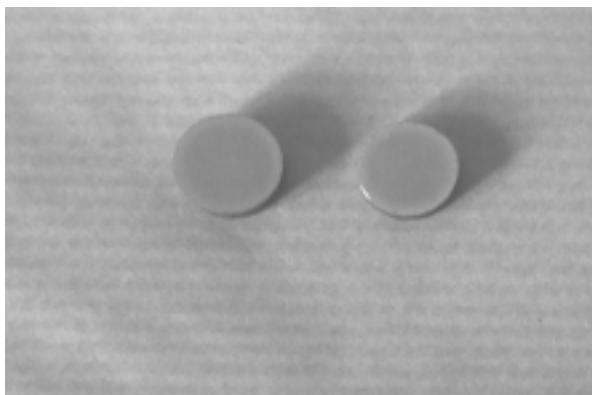
Tabela 1: Pregled vzorcev, izdelanih z SHS-sintezo
Table 1: Overview of samples after SHS synthesis

Oznaka vzorca	Sestava	Začetna poroznost (%)	Pogoji pri sintezi	Zrnatost uporabljenih prahov
1	Ni ₃ Al	14,3	Ar	Ni < 10 μm Al 32-50 μm
2	Ni ₃ Al	33,7	Ar	Ni < 10 μm Al 32-50 μm
3	Ni ₃ Al	36,2	Ar	Ni < 10 μm Al 32-50 μm
4	Ni ₃ Al	37,3	Ar	Ni < 10 μm Al 32-50 μm
5	Ni ₃ Al	31,4	Vakuum	Ni < 10 μm Al 32-50 μm
6	TiAl ₃	18,7	Ar	Ti 40-50 μm Al 32-50 μm
7	TiAl ₃	18,3	Ar	Ti 1-3 μm Al 32-50 μm



Slika 3: Vzorci Ni₃Al po SHS-sintezi zbrušeni, polirani in ionsko nitrirani v pulzirajoči plazmi

Figure 3: Samples of Ni₃Al after SHS synthesis, ground, polished and ion nitrided in a pulsed plasma



Slika 4: Vzorci TiAl₃ po SHS-sintezi zbrušeni, polirani in ionsko nitrirani v pulzirajoči plazmi

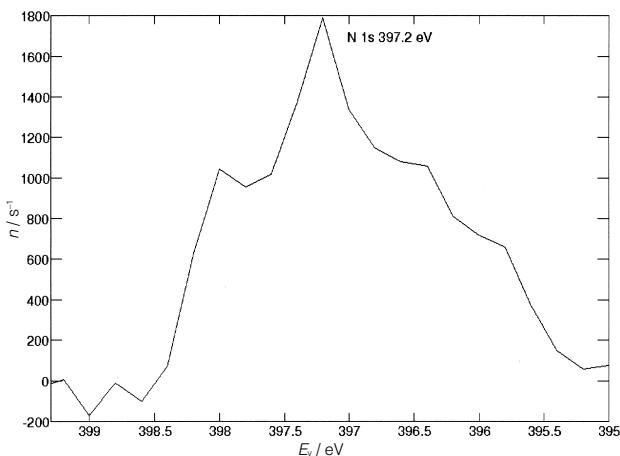
Figure 4: Samples of TiAl₃ after SHS synthesis, ground, polished and ion nitrided in a pulsed plasma

XPS-analiza je bila izvršena z napravo VG Microlab 310-F. Izvir sevanja je bil Mg K α (1253,6 eV). Vzorci so bili več minut jedkani z Ar-ioni, da bi se očistila kontaminirana površina. Iz parametrov ionskega nitriranja izhaja, da je bila hitrost jedkanja 0,002 nm/s. XPS-meritve so bile izvršene pred jedkanjem in po njem.

3 REZULTATI Z DISKUSIJO

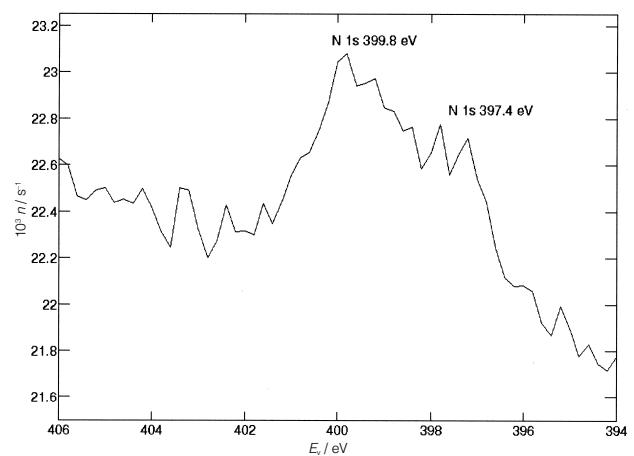
Analizo XPS smo izvršili pred jedkanjem in po njem. Poleg razlike v intenziteti ni bilo opaziti razlike med obema spektroma.

Analiza Ni₃Al je potrdila prisotnost N 1s pri 397,2 eV. Poleg tega je bil opazen tudi Ni LMM- Augerjev prehod. Z odštetjem ozadja pokaže detalj N 1s vrednost vezavne energije 397,2 eV, ki ustreza nitridom. Ker tvorba Ni-nitrida ni poznana, lahko sklepamo, da gre v tem primeru za Al-nitrid AlN (**slika 5**). To dodatno potrjuje meritev, kjer smo za Ni 3p3/2 in Ni 3p1/2 dobili vrednosti 66,4 eV oziroma 68,6 eV, kar ustreza Ni v Ni₃Al (**slika 6**). Podobno velja za Al 2p, kjer 72,3 eV



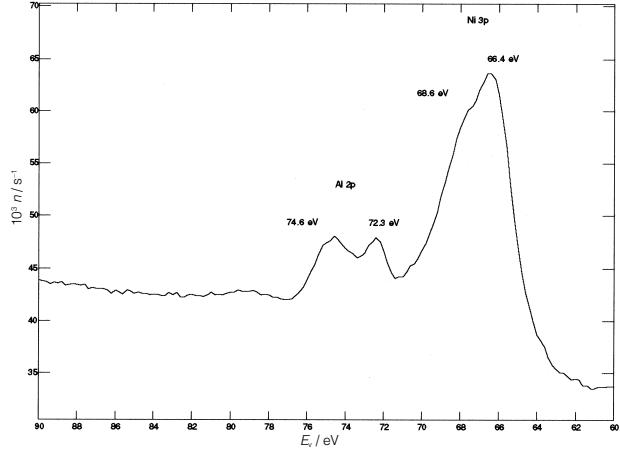
Slika 5: Vrh v spektru vezavne energije N 1s pri 397,2 eV potrjuje prisotnost N v Ni₃Al

Figure 5: The peak in the spectrum of the binding energy for N 1s at 397.2 eV confirms the presence of N in Ni₃Al



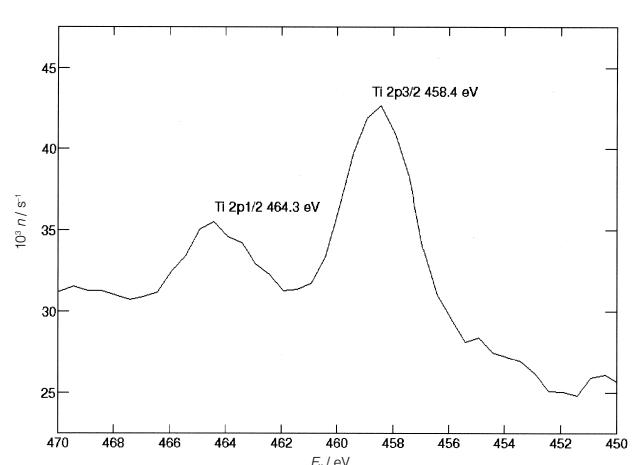
Slika 7: Vzorec TiAl₃. Spekter vezavne energije N 1s pri 399,8 eV ustreza vezavi N v organsko matriko, 397,4 eV pa N v nitridu AlN

Figure 7: Sample of TiAl₃. Spectrum of binding energy N 1s at 399.8 eV corresponds to N in an organic matrix, but 397.4 eV corresponds to N in AlN



Slika 6: Spekter vezavne energije: Al 2p pri 72,3 eV ustreza vezavi Al v Ni₃Al, 74,6 eV pa vezavi Al v AlN. Ni 3p pri 68,6 eV in 66,4 eV ustreza vezavi Ni v Ni₃Al.

Figure 6: Spectrum of binding energy Al 2p at 72.3 eV corresponds to Al in Ni₃Al, 74.6 eV corresponds the Al bound in AlN. Ni 3p at 68.6 and 66.4 eV corresponds to the Ni in Ni₃Al.



Slika 8: Spekter vezavne energije Ti. Vrednosti 464,3 eV in 458,4 eV ne potrjujeta prisotnosti Ti nitrida. Nitridu TiN bi ustrezaла vrednost 454,5 eV.

Figure 8: Spectrum of binding energy of Ti 464.3 eV and 458.4 eV does not correspond to Ti-nitride. For TiN the value should be 454.5 eV.

ustreza Al v Ni₃Al, pri Al 2p dobljena vrednost vezavne energije 74,6 eV pa ustreza Al v AlN. Nizka intenziteto N 1s pri 397,2 eV, ki ustreza N v AlN, kaže, da obstaja možnost, da del intenzitete Al 2p pri 74,6 eV izvira iz Al v Al-oksidu.

Pri vzorcu TiAl₃ izmerjena vrha vezavne energije za Ti 2p_{3/2} in Ti 2p_{1/2} pri 458,4 eV in 464,3 eV kažeta, da obe vrednosti izključujejo prisotnost TiN, ker je potrebna energija vezave za Ti 2p_{3/2} v TiN nitridu 454,5 eV. Glede na nizko intenziteto N 1s pri 397,4 eV je mogoče, da del intenzitete Al 2p pri 74,8 eV prihaja iz Al v Al-oksidu. Torej obstoja nitrida v vzorcu TiAl₃ nismo mogli zanesljivo potrditi (sliki 7 in 8).

Na podlagi izvršenih meritev pri vzorcih iz Ni₃Al in TiAl₃ lahko ugotovimo, da so pri ionskem nitriranju tvorili samo nitridi AlN.

4 SKLEPI

Raziskava je pokazala, da pri SHS-sintezi mešanice elementnih prahov nastane porozen aluminid. Pri uporabljenih pogojih ionskega nitriranja v pulzirajoči plazmi so nastali površinski nitridi AlN na obeh materialih, medtem ko pogoji za tvorbo nitridov TiN na zlitini TiAl₃ niso bili primerni.

ZAHVALA

Projekt je sofinanciralo Ministerstvo za šolstvo, znanost in šport. Šifra projekta: SLO-IZR-2001/05, št. pogodbe: 3311-01-838098

² M. Torkar, V. Rosenband, Program and book of abstracts, 11th Conference on Materials and Technology, October 1-3, 2003, Portorož, 103

³ J. Patscheider: Nanocomposite hard coatings for wear protection, MRS Bulletin, 28 (**2003**)3, 180-183

⁴ M. Torkar, V. Leskovšek: Pulsed-plasma nitriding of FeAl-12.5 alloy, Intermetallics 3 (**1995**) 427-430

5 LITERATURA

- ¹ M.Torkar, B. Šuštaršič, M. Doberšek, I. Naglič, Final report of the project Combustion synthesis of the complex nitrides of intermetallics, SLO-IZR-2001/05, Ljubljana, january 2003